RECORD COPY

PCT

REQUEST

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty

| | For receiving Office use of | only |
|---------------|---|------------------|
| | PCT/SE00/00 | 066 |
| International | Application No. | |
| | 1 4 -01- | 2000 |
| International | Filing Date | |
| | The Swedish Patent Offi PCT International Applic | ice etion |
| Name of rece | iving Office and PC1 Internation | mal Application" |
| | or agent's file reference 2 characters maximum) | 08375 |

| | (if desired)(12 characters maximum) |
|--|--|
| Box No. I TITLE OF INVENTION | |
| COPPER RECOVERY PROCESS | • |
| · | |
| | |
| Box No. II APPLICANT | |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full offi must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | Box is the applicant's State (that |
| MECER HOLDINGS CORP. | Telephone No. |
| c/o Sigma Metallextraktion AB | |
| Datavägen 51 | Facsimile No. |
| SE-436 32 ASKIM | |
| Sweden | Teleprinter No. |
| | |
| State (that is, country) of nationality: Sweden S | tate (that is, country) of residence: Sweden |
| This person is applicant for the purposes of: all designated less expected to the United States of American less than the Uni | |
| Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR /FURTHE | R INVENTOR(S) |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full office must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | Box is the applicant's State (that |
| PACHOLIK, Robert | applicant only |
| Askims Högalid 12 | applicant and inventor |
| SE-436 51 ASKIM | inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) |
| Sweden | |
| State (that is, country) of nationality: Sweden S | tate (that is, country) of residence: Sweden |
| This person is applicant all designated all designated States ex- for the purposes of: States all designated the United States of Am | |
| Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a con | |
| Box No. IV AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR | ADDRESS FOR CORRESPONDENCE |
| The person identified below is the person identified below is the applicant(s) before the competent International Authorities as: | agent common representative |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal ent address must include postal code and name of country.) | |
| AWAPATENT AB | Facsimile No. |
| Box 45086 | +46 8 440 95 50 |
| SE-104 30 STOCKHOLM | Teleprinter No. |
| Sweden | |
| Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or instead to indicate a special address to which correspondence should be set | common representative is/has been appointed and the space above is used nt |

Sheet No. 1a

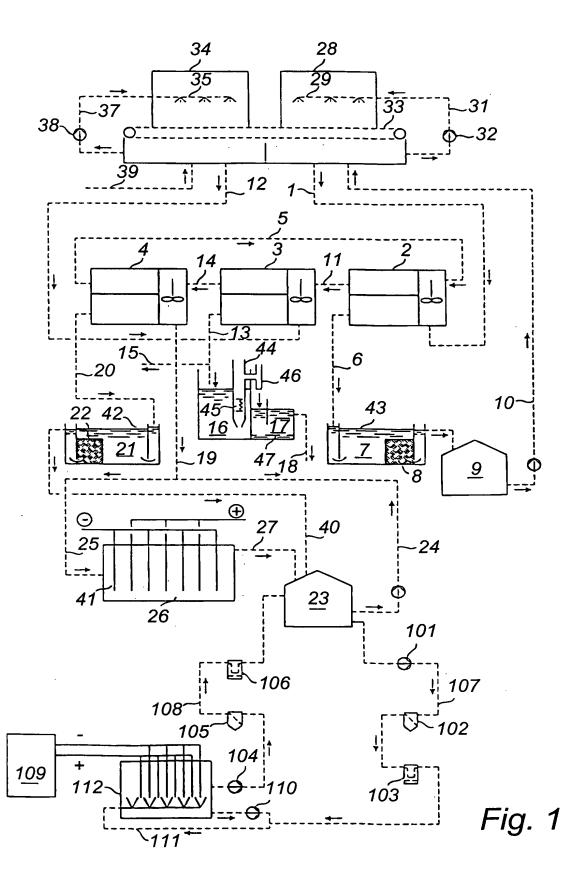
| Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| If none of the following sub-boxes is used , th | nis sheet should not be included in the request | | | | |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full of must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | This person is: The applicant's State (that | | | | |
| LIDMER, Gunnar | applicant only | | | | |
| Ängås 32-35 | applicant and inventor | | | | |
| SE-434 93 VALLDA | inventor only (If this check-box | | | | |
| Sweden | is marked, do not fill in below.) | | | | |
| State (that is, country) of nationality: Sweden | State (that is, country) of residence: Sweden | | | | |
| This person is applicant for the purposes of: all designated the United States of A | | | | | |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full off must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | | | | | |
| • | applicant only | | | | |
| | applicant and inventor | | | | |
| | inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) | | | | |
| State (that is, country) of nationality: | State (that is, country) of residence: | | | | |
| This person is applicant for the purposes of: all designated the United States of A | | | | | |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full off must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | | | | | |
| | applicant only | | | | |
| | applicant and inventor | | | | |
| | inventor only (If this check-box | | | | |
| | is marked, do not fill in below.) | | | | |
| State (that is, country) of nationality: | State (that is, country) of residence: | | | | |
| This person is applicant for the purposes of: all designated the United States of Arthur Designated States of Art | | | | | |
| Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full offi must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) | | | | | |
| | applicant only | | | | |
| | applicant and inventor | | | | |
| | inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.) | | | | |
| State (that is, country) of nationality: | State (that is, country) of residence: | | | | |
| This person is applicant for the purposes of: all designated all designated the United States of Ar | | | | | |
| Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another conti | inuation sheet. | | | | |
| Form PCT/PO/101 (continuation sheet) (July 1009; remaint January 2000) | | | | | |

Sheet No. 2

| Box N | | DESIGNATION O | | 7: 11 / | | |
|------------------------|---------|-------------------------|--|---|-----------|---|
| i | | - | eby made under Rule 4.9(a) (mark the | applicable ched | :k-boxes; | at least one must be marked): |
| _~ | nal Pa | tent | | | | |
| | AP | | | | | SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT |
| | EA | | | | | Z Kazakhstan, MD Republic of Moldovia, RU Russian acting State of the Eurasian Patent Convention and of the |
| \boxtimes | EP | ES Spain, FI Finland | , FR France, GB United Kingdom, G | R Greece, IE Ir | eland, IT | nstein, CY Cyprus, DE Germany, DK Denmark, I Italy, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Netherlands, uropean Patent Convention and of the PCT |
| \boxtimes | | GN Guinea, GW Gui | inea-Bissau, ML Mali, MR Mauritani | a, NE Niger, SI | N Senega | ngo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, al, TD Chad, TG Togo, and any other State which is a tion or treatment desired, specify on dotted line) |
| Natio | nal Pat | ent (if other kind of p | rotection or treatment desired, specify | on dotted line) | : | |
| \boxtimes | AE | United Arab | | ⊠ĺ | LR | Liberia |
| \boxtimes | AL | Albania | · | ☒ | LS | Lesotho |
| $\overline{\boxtimes}$ | AM | Armenia | | \boxtimes | LT | Lithuania |
| M | ΑT | Austria | +Utility Model | X | ĿU | Luxembourg |
| X | AU | Australia | | \bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{ | LV | Latvia |
| | ΑZ | Azerbaijan | | \(\overline{\overlin | MA | Morocco |
| 2 | BA | Bosnia and I | - Herzegovina | | MD | Republic of Moldova |
| | BB | Barbados | Terzegovina | ⊠ | MG | Madagascar |
| | BG | | | | MK | The former Yugoslav Republic of Macedonia |
| | | Bulgaria | ************************************** | 🖂 | WIK | The former Fugosiav Republic of Macedonia |
| | BR | Brazil | | | 2421 |) |
| | BY | Belarus | MANAGER PLANT AND | ⊠ | MN | Mongolia |
| Z | CA | Canada | *** | X | MW | Malawi |
| \bowtie | | | and Liechtenstein | ☒ | MX | Mexico |
| \boxtimes | CN | China | | <u> </u> | NO | Norway |
| \boxtimes | CR | Costa Rica | | | NZ | New Zealand |
| \boxtimes | CU | Cuba _ | | ⊠ | PL | Poland |
| \boxtimes | CZ | Czech Republic | +Utility Model | 🛛 | PT | Portugal |
| \boxtimes | DE | Germany | +Utility Model | ⊠ | RO | Romania |
| \boxtimes | DK | Denmark | +Utility Model | 🛛 | RU | Russian Federation |
| \boxtimes | DM | Dominica | | | SD | Sudan |
| \boxtimes | EE | Estonia | +Utility Model | ⊠ | SE | Sweden |
| \boxtimes | ES | Spain | | ⊠ | SG | Singapore |
| | FI | Finland | +Utility Model | ⊠ | SI | Slovenia |
| \boxtimes | GB | United Kingdom | | oxtimes | SK | Slovakia +Utility Model |
| \boxtimes | GD | Grenada | | oxtimes | SL | Sierra Leone |
| \boxtimes | GE | Georgia | | | TJ | Tajikistan |
| \boxtimes | GH | Ghana | | ⊠ | TM | Turkmenistan |
| | GM | Gambia | | ⊠ | TR | Turkey |
| \boxtimes | HR | Croatia | HILLI PROPERTY OF THE PROPERTY | ⊠ | TT | Trinidad and Tobago |
| \boxtimes | HU | Hungary | | 🛛 | TZ | United Republic of Tanzania |
| \boxtimes | ID | Indonesia | | \boxtimes | UA | Ukraine |
| \boxtimes | IL | Israel | | 🛛 | UG | Uganda |
| \boxtimes | IN | India | | 🛛 | US | United States of America |
| \boxtimes | IS | Iceland | • | | | |
| \boxtimes | JP | Japan | | ⊠ | UZ | Uzbekistan |
| \boxtimes | KE | Kenya | | ⊠ | VN | Viet Nam |
| \boxtimes | KG | Kyrgyzstan | | ⊠ | YU | Yugoslavia |
| \boxtimes | KP | Democratic People' | s Republic of Korea | \boxtimes | ZA | South Africa |
| | | | | \square | ZW | Zimbabve |
| \boxtimes | KR | Republic of Korea | +Utility Model | | | eserved for designating States which have become party |
| \boxtimes | KZ | Kazakhstan | | to the | PCT afte | er issuance of this sheet: |
| \boxtimes | LC | Saint Lucia | | | ····· | |
| \boxtimes | LK | Sri Lanka | | | | |
| Preca | utionar | v Designation Statem | ent: In addition to the designations m | ade above the | applicant | t also makes under Rule 4.9(b) all other designations |

which would be permitted under the PCT except any designations are subject to confirmation and that any designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including fees) must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)
Form PCT/RO/101 (second sheet) (January 2000)

| | | | Sheet No. 3 | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Box No. VI PRIO | RITY CLAIM | | ☐ Further priority | y claims are indicated in the | ne Supplement Box. |
| Filing date | Number | | : | Where earlier applicati | |
| of earlier application | of earlier applicatio | n | national application | | |
| (day/month/year) | | | country | regional Office | receiving Office |
| item (1) | | | | | |
| 02-03-1999 | 9900748-6 | | Sweden | | ļ |
| (02 March 1999) | | | | ! | 1 |
| item (2) | | | | | |
| | i | | | l | |
| | | | | | |
| item (3) | | | | | |
| nem (3) | | | | | |
| | | • | - | | |
| | | | <u> </u> | | |
| The receiving Office | is requested to prepare a | nd trans | mit to the Internations | al Bureau a certified copy | of |
| the earlier applicatio | n(s) (only if the earlier ap | pplicatio | n was filed with the C | Office which for the purpos | ses |
| of the present interno | ational application is the | receivin | g Office) identified ab | oove as item(s): | 1 |
| * Where the earlier application is | | | | | |
| Convention for the Protection of | Industrial Property for whic | h that ear | lier application was file | ed (Rule 4.10(b)(ii)). See Supp | elemental Box. |
| Box No. VII INTERN | NATIONAL SEARCHI | NG AU | THORITY | | |
| Choice of International Sea | rching Authority (ISA) | Reque | st to use results of es | arlier search; reference t | o that search |
| (If two or more International Aut. | | | | • | om the International Searching |
| carry out the international search | | Authori | | arried out by or requested fro | m the international bear crimg |
| chosen; the two-letter code may b | oe used): | | ay/month/year) | Number | Country (or regional Office) |
| | | • | | | |
| ISA / se | | 11 Ma | y 1999 | SE99/00541 | Sweden |
| Box No. VIII CHEC | K LIST; LANGUAGE | OF FIL | ING | | |
| | | | | | and a distance |
| This international application con number of sheets: | tains the following | i nis inten | national application is a | ccompanied by the item(s) m | iarked below: |
| request | . 40 | . I⊠ 600 | calculation sheet | | |
| description (excluding sequence l | | | | | |
| claims | | | arate signed power of att | | |
| | . 11 | | | torney; reference No., if any: | } |
| abstract | 1 | | ement explaining lack of | _ | |
| drawings | : 2 0 5 | 5. 🔲 pric | rity document(s) identif | ied in Box No. VI as item(s): | |
| sequence listing part of description | n : [6 | 5. 🔲 tran | slation of international a | applications into (language): | |
| | 7 | 7. 🔲 sepa | arate indications concern | ning deposited microorganism | or other biological material |
| | | | | d sequence listning in compu | - |
| Total number of sheets | | | | orisation. Copy o | |
| Figure of the drawings which | | | of filing of the | | L IIB-Kepoit |
| should accompany the abstract: | | | nal application: | Swedish | |
| | RE OF APPLICANT O | | | | |
| | | | | | |
| Next to each signature, indicate the | he name of the person signin | ig and the | capacity in which the p | erson signs (if such capacity | is not obvious from reading the |
| request). | | | | | |
| AWAPATENT AB | | | | | |
| | | | | | |
| <u>v−</u> ,/ · | | | | | |
| The tars | ~ <u>~</u> | | | | |
| | | | | | |
| Kjëll Larsson | | | - | | |
| Authorised agent | | | | | |
| | | For | receiving Office use only | | |
| 1. Date of actual receipt of the | 1 4 | T-01- | 2000 | | 2. Drawings: |
| Purported international applic | cation: | | | | |
| Corrected date of actual recei | | | | | received: |
| I imely received papers or dra | awings completing the purported | internatio | nai application: | | |
| 4. Date of timely receipt of the | | | | | not received: |
| Corrections under PCT Articl | | | | | |
| 5. International Searching Authority or more are compaten | | | | Transmittal of search copy | |
| (if two or more are competen | η. 13 <i>N</i> Δ <i>C</i> | | | delayed until search fee is paid. | |
| | | For Int | ernational Bureau use only | · | |
| Date of receipt of the record copy | by the 4 5 FES?! | | - | | (1 5, 02, 00) |
| International Bureau | I U PENKI | JAMI . | r.uu u | | (|



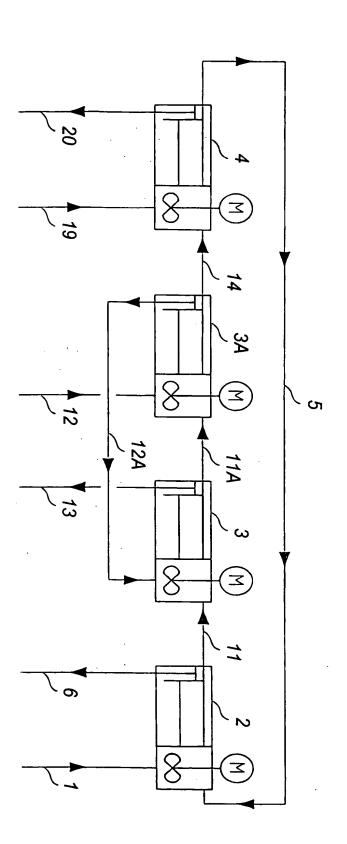


Fig. 2



Mecer Holdings Corp.
Ansökningsnr Referens

1

KOPPARÅTERVINNINGSFÖRFARANDE

Tekniskt område

Föreliggande uppfinning hänför sig till teknikområdet återvinning av etsbad från en etsprocess där mönsterkort belagda med koppar etsas med det alkaliska etsbadet och sedan sköljs med vatten. Återvinning av koppar från ett sådant etsbad liksom återvinning av etsbadet i sig är i och för sig förut kända, men uppfinningen avser återvinning av koppar på ett i dessa sammanhang helt nytt och mycket fördelaktigt sätt.

10

15

20

25

30

Bakgrund till uppfinningen

Elektronisk utrustning är idag huvudsakligen uppbyggd av komponenter fastlödda på mönsterkort. Tillverkningen av dessa mönsterkort har ökat mycket snabbt. Avancerad elektronik, såsom exempelvis datorer, kräver mycket komplicerade mönsterkort och tillverkningen av dessa har inneburit att en specialindustri har vuxit upp.

Ett mönsterkort består av en platta av ett basmaterial, vilket ofta är en plast, t.ex. epoxi. Denna platta är på båda sidorna belagd med ett tunt (t.ex. ca 15-20 μ m) kopparskikt.

Tillverkningen av dessa mönsterkort kan exempelvis ske på följande sätt. Enligt ett förutbestämt mönster borras hål av olika storlek i plattorna så att kanaler skapas mellan de båda sidorna och så att hål skapas, i vilka komponenter kan monteras. Därefter beläggs alla ytor med ett ca 2-4 µm tjockt skikt av koppar, som påföres på kemisk väg i stället för elektrokemiskt. Detta är nödvändigt eftersom hålväggarna utgörs av ett material (t.ex. epoxi) på vilket det inte går att använda sig av elektrokemisk plätering. På detta sätt har man sålunda skapat en hel och obruten kopparyta, vilken därefter kan beläggas med hjälp av elektrokemisk plätering.

Nästa steg i tillverkningen av mönsterkort innebär

att man skapar det önskade ledningsmönstret. För detta ändamål beläggs de ytor som skall vara fria från koppar med en icke ledande skyddsfilm, och korten matas in i en s.k. elpläteringslinje. Denna linje innefattar en mängd olika bad, i vilka korten doppas.

5

10

15

20

I ett av dessa bad beläggs de exponerade kopparytorna med ytterligare koppar för åstadkommande av önskad
tjocklek på ledare, varefter samma ytor beläggs med ett
lager tenn, vilket kommer att fungera som skydd vid den
senare etsningen.

Därefter vidtar etsningen av ifrågavarande mönsterkort, vilken vanligtvis sker med alkaliska lösningar. Dessa är företrädesvis ammoniakaliska och innehåller fri ammoniak och ett eller flera ammoniumsalter (t.ex. NH4Cl, NH4HCO3). Vid etsningen avlägsnas koppar från de ytor av mönsterkortet där kopparskiktet är exponerat mot lösningen. Efterhand stiger kopparhalten i badet till en nivå, där etsningshastigheten avtar drastiskt och badet inte längre är användbart. Vanligtvis gäller att denna övre gräns för kopparhalten uppgår till ca 150-170 g/l, beroende på badets sammansättning i övrigt. Efter etsningen sköljs mönsterkorten rena med vatten.

Korten går därefter vidare för strippning av tenn och beläggning med lack och vax, mm.

Ett förfarande för regenerering av etsbadet vid en process av detta slag är förut känt genom EP-B1-0 005415. Detta förfarande kan anslutas direkt till etsprocessen och innebär kortfattat att etsbadet regenereras för ny användning vid en etsprocess, varvid koppar avlägsnas från etsbadet medelst extraktion. Förfarandet möjliggör även behandling av sköljvattnet så att detta därefter kan släppas ut i naturen på ett miljövänligt sätt. Den koppar som extraheras från etsbadet och företrädesvis även från sköljvattnet återvinnes som metallisk koppar genom elektrolys.

Beskrivning av uppfinningen

5

10

15

20

25

30

35

Föreliggande uppfinning avser ett nytt och i detta sammanhang synnerligen fördelaktigt förfarande för återvinning av koppar från ett alkaliskt etsbad av ovan angivet slag. Enligt uppfinningen har det sålunda överraskande visat sig att man inte bara kan återvinna koppar från etsbadet och företrädesvis också från sköljvattnet på ett alternativt nytt sätt utan också återanvända återvunnen koppar i pläteringsprocessen. Generellt innebär förfarandet enligt uppfinningen att kopparinnehållande lösning erhållen efter extraktionen från det alkaliska etsbadet direkt kan återanvändas vid pläteringen av mönsterkorten, om man från den från återextraktionssteget erhållna kopparinnehållande syralösningen avleder ett flöde och balanserar kopparhalten mellan detta flöde och den syralösning som uttas för utvinning av koppar, t.ex. metallisk koppar genom elektrolys. Härigenom reducerar man behovet av kostnadskrävande elektrolys för återvinning av metallisk koppar, samtidigt som man också reducerar eller eliminerar behovet av tillsats av dyrbar anodkoppar vid pläteringen. Dessutom kan man på ort och ställe direkt utnyttja den återvinningskoppar som man tidigare enbart har kunnat sälja till ett pris av ca ¼ av priset för nämnda anodkoppar och detta med en kvalitet vid pläteringen som är minst lika bra eller t.o.m. bättre än kvaliteten vid plätering enligt tidigare kommersiellt använd pläteringsteknik.

En förutsättning för framgångsrik plätering, dvs med god ytjämnhet och god beläggning i hål och liknande, i samband med tidigare använd kommersiell metodik för elplätering har dessutom varit tillsats av ett flertal olika kemikalier. Förutom att dessa kemikalier till viss del har varit icke-kompatibla med reagens använda vid extraktionen, och därmed måste avlägsnas enligt tidigare teknik, vilket har komplicerat och fördyrat processen, har det sålunda visat sig att användningen av dessa kemikalier kan reduceras eller helt elimineras vid förfarandet

enligt föreliggande uppfinning, om pläteringen utföres under speciella betingelser, i synnerhet pulsplätering. Enligt uppfinningen har det sålunda visat sig att minst lika goda resultat som enligt tidigare känd teknik kan uppnås med denna nya metodik enligt uppfinningen, vilket innebär avsevärda kostnadsmässiga och miljömässiga fördelar. Förutom att processen blir enklare och billigare gäller dessutom att förfarandet enligt uppfinningen möjliggör en helt sluten eller kontinuerlig process, där även pläteringssteget kan inkluderas i den tidigare kända etsnings- och återvinningsprocessen.

5

10

15

20

25

30

35

Ytterligare fördelar med uppfinningen kommer att framgå av nedanstående beskrivning.

I detta sammanhang kan det tilläggas att pulsplätering av mönsterkort är i och för sig känd genom Processing of Advanced Materials (1994) 9, sid 148-154, men att denna publikation inte på något sätt avslöjar eller ens antyder att en sådan plätering skulle kunna integreras i ett förfarande av det slag som föreliggande uppfinning avser och ännu mindre under de betingelser och med de resultat som gäller för densamma.

Förfarandet enligt uppfinningen är sålunda ett förfarande för återvinning av koppar från ett alkaliskt, företrädesvis ammoniakaliskt, etsbad från en etsprocess, där mönsterkort elektropläterade med koppar etsas med det alkaliska etsbadet och sedan sköljs med vatten, varvid man avlägsnar en del av kopparinnehållet i det alkaliska etsbadet genom extraktion med en organisk lösning innehållande ett reagens, som med koppar bildar en komplex förening, vilken extraheras av den organiska lösningen, återför det alkaliska etsbadet till förnyad etsning, i ett återextraktionssteg bringar den organiska lösningen innehållande koppar i kontakt med en vattenlösning av syra, företrädesvis svavelsyra, så att koppar övergår från den organiska lösningen till vattenlösningen, och återför den organiska lösningen från återextraktionssteget till förnyad extraktion. Det utmärkande för förfarandet enligt uppfinningen är härvid att man leder den från återextraktionssteget erhållna kopparinnehållande syralösningen till en operation för utvinning av koppar, företrädesvis för framställning av metallisk koppar genom elektrolys, att man från den kopparinnehållande syralösningen, före operationen för utvinning av koppar från densamma, avleder ett flöde och reglerar kopparhalten i detta flöde så att den blir lägre än kopparhalten i den syralösning som används i operationen för utvinning av koppar, och att man recirkulerar detta flöde med reglerad kopparhalt till operationen för elektroplätering av mönsterkort för användning vid denna.

Enligt en föredragen utföringsform av förfarandet avlägsnar men dessutom koppar från sköljvattnet från etsprocessen genom extraktion med en organisk lösning innehållande ett reagens, som med koppar bildar en komplex förening vilken extraheras av den organiska lösningen.

En utföringsform av sistnämnda förfarande innebär härvid att man använder samma organiska lösning för sköljvattnet som för det alkaliska etsbadet och därvid först avlägsnar koppar från det alkaliska etsbadet, därefter bringar den därvid erhållna kopparhaltiga organiska lösningen i kontakt med sköljvattnet och sedan utsätter den organiska lösningen för nämnda återextraktion.

En annan utföringsform av nämnda förfarande innebär att man använder samma organiska lösning för sköljvattnet som för det alkaliska etsbadet och därvid först avlägsnar koppar från sköljvattnet, därefter bringar den därvid erhållna kopparhaltiga organiska lösningen i kontakt med det alkaliska etsbadet och sedan utsätter den organiska lösningen för nämnda återextraktion.

En speciellt föredragen utföringsform av förfarandet enligt uppfinningen innebär att detta utföres som ett slutet förfarande, där det pläterade mönsterkortet etsas med nämnda alkaliska etsbad och syralösningen från pläteringen utnyttjas för nämnda återextraktionssteg. Allra helst recirkuleras också syralösningen från operationen

10

15

20

25

30

för utvinning av koppar till återextraktionssteget eller -stegen.

Enligt uppfinningen har det visat sig att utomordentliga resultat uppnås om man reglerar flödet så att förhållandet kopparhalt i nämnda flöde:kopparhalt i nämnda syralösning blir > 0,3:1, företrädesvis > 0,5:1. Enligt en speciellt föredragen utföringsform av förfarandet enligt uppfinningen reglerar man härvid flödet så att nämnda förhållande ligger inom intervallet 0,60:1-0,95:1, allra helst 0,75:1-0,95:1.

5

10

15

20

25

30

35

Såsom antyddes ovan innebär en speciellt fördelaktig utföringsform av förfarandet att pläteringen utföres i form av en pulsplätering. Med pulsplätering förstås härvid att man utför pläteringen med polvändning och/eller varierande pulser för strömstyrka. Detta kan åstadkommas med lämplig likriktarutrustning. De varierande pulserna och/eller polvändningen kan vara regelbundet eller oregelbundet vågformade, lämpligen fyrkantformade. Beträffande denna teknik i sig gäller att uppgifter kan hämtas från ovannämnda publikation avseende pulsplätering rent generellt, men enligt uppfinningen har det visat sig att fördelaktiga resultat uppnås under speciella betingelser. Dessa betingelser kan sammanfattas enligt följande.

Pulspläteringen utföres företrädesvis med en pulslängd för de vågformade pulserna inom intervallet 1-500 ms, företrädesvis 10-50 ms. För dessa pulser gäller att man kan ha pulslängder som varierar inom de angivna intervallen eller att man arbetar med väsentligen samma, eller exakt samma, pulslängd för pulstoppar som för pulsbottnar, dvs den tidsperiod under vilken de vågformade, företrädesvis fyrkantformade, pulserna ligger på maximal respektive minimal strömstyrka alternativt maximal strömstyrka för +-spänning respektive -spänning.

Företrädesvis reglerar man den tid under vilken mönsterkortet fungerar som katod vid pulspläteringen till ett värde inom intervallet 1-200 s, speciellt 10-100 s.

Den tid under vilken mönsterkortet fungerar som anod vid pulspläteringen reglerar men företrädesvis till ett värde inom intervallet 0,1-20 s, speciellt 1-10 s.

Den maximala strömstyrkan under den period då mönsterkortet fungerar som katod vid pulspläteringen är lämpligen 10 A/dm^2 , företrädesvis 5 A/dm^2 och allra helst 3 A/dm^2 .

5

10

15

20

35

Den maximala strömstyrkan under den period då mönsterkortet fungerar som anod vid pulspläteringen är företrädesvis 40 A/dm^2 , ännu hellre 10 A/dm^2 och allra helst 5 A/dm^2 .

Generellt gäller härvid att den genomsnittliga strömstyrkan då mönsterkortet fungerar som anod är större än den genomsnittliga strömstyrkan då mönsterkortet fungerar som katod.

Enligt uppfinningen har det vidare visat sig att utomordentliga resultat uppnås om man reglerar kopparhalten
för det till pläteringen recirkulerade flödet till ett
värde inom intervallet 5-100 g/l, företrädesvis 10-50
g/l, ännu hellre 15-30 g/l och allra helst 20-25 g/l.

För en sådan reglering gäller att en reglering av kopparhalten för den till pläteringen recirkulerade strömmen genom tillsats av syra från återextraktionssteget har visat sig fungera synnerligen bra.

Generellt gäller företrädesvis samma storleksordning för kopparhalten i den syralösning som används i operationen för utvinning av koppar, dock med den för uppfinningen väsentliga regleringen av förhållandet mellan kopparhalterna i sagda flöde resp. sagda syralösning. Operationen för utvinning av koppar är lämpligen, men inte nödvändigtvis, en operation för utvinning av metallisk koppar genom elektrolys. Detaljer för sådan elektrolys i sig kan hämtas från den kända tekniken.

För syrahalten, eller halten av anjon från den syra som används vid återextraktionen, vilken företrädesvis är sulfat, då den föredragna syran är svavelsyra, gäller generellt att den regleras till ett värde inom intervallet

25-500 g/l, företrädesvis 50-200 g/l. Detta gäller både syralösningen för operationen för utvinning av koppar och flödet för plätering, vilka dessutom lämpligen har väsentligen, eller exakt, samma syrahalt.

5

10

15

20

25

30

35

En annan variant av förfarandet enligt uppfinningen representeras av det fall då man efter plätering av koppar vänder polariteten för pläteringen så att man därigenom kan utnyttja tidigare pläterad koppar som ett buffertlager av koppar i den händelse att mängden koppar som fås från extraktionen understiger behovet vid pläteringen.

En annan stor fördel med uppfinningen är, såsom har antytts ovan, att det nya förfarandet enligt uppfinningen möjliggör pulsplätering helt utan tillsatser av det slag som tidigare har använts vid icke-pulsplätering av mönsterkort. Förutom att detta givetvis innebär stora ekonomiska vinster har detta också bidragit till att pläteringen över huvudtaget har kunnat integreras på det beskrivna fördelaktiga sättet vid ett kopparåtervinningsförfarande av det angivna slaget.

Bland andra faktorer som påverkar pläteringen kan nämnas halten av alkaliskt ämne härrörande från etsbadet samt halten av organiskt material härrörande från extraktionen. Enligt uppfinningen har det sålunda visat sig att utomordentliga resultat kan uppnås vid förfarandet enligt uppfinningen om man före pläteringen reducerar, och företrädesvis eliminerar, halten av nämnda alkaliska ämne och/eller halten av nämnda organiska material i den till pulspläteringen recirkulerade strömmen.

Denna reducering eller dessa reduceringar kan göras i olika skeden av förfarandet enligt uppfinningen, men en speciellt föredragen utföringsform representeras av det fall där ifrågavarande reducering(ar) utförs med hjälp av ett eller flera separata vattentvättningssteg i anslutning till den utrustning som används för extraktionen. Sådana vattentvättningssteg införlivas företrädesvis före det sista steget av extraktionsprocessen.

Ifrågavarande reducering(ar) kan också utföras med hjälp av ett eller flera filter, företrädesvis filter av typ kolfilter och/eller ultrafilter. Även sådana filter kan placeras in på olika ställen i processen, men en fördelaktig placering är i den separata slinga som representeras av det till pläteringen recirkulerade flödet.

En annan fördelaktigt utföringsform av förfarandet enligt uppfinningen representeras av det fall då man före pläteringen avlägsnar kolloidal koppar, företrädesvis med hjälp av ett eller flera filter, speciellt ultrafilter, från den till pulspläteringen recirkulerade strömmen.

Såsom kommer att belysas mera nedan i samband med de på ritningen visade utföringsformerna har man vid extraktionen enligt tidigare teknik utnyttjat mixer-settleranordningar för ifrågavarande extraktion. Enligt uppfin-. 15 ningen har det nu dock visat sig att speciellt gynnsamma resultat vid pläteringen kan uppnås om dessa mixersettleranordningar helt eller delvis ersätts med en eller flera extraktorer. Sådana extraktorer är givetvis i och 20 för sig förut kända men har sålunda visat sig ge fördelaktiga resultat i samband med uppfinningen. Med extraktor menas härvid i princip en anordning där ovannämnda settler i mixer-settleranordningen är utbytt mot en centrifug eller annat separeringsorgan där energi tillförs utifrån, 25 till skillnad från en settler, som i princip bygger på utnyttjande av tyngdkraften.

Ritning

30

35

5

10

Fig. 1 visar schematiskt en utföringsform av förfarandet enligt uppfinningen, och Fig. 2 visar schematiskt en alternativ utföringsform av den mixer-settleranläggning som ingår i anläggningen visad i Fig. 1.

De komponenter som ingår i den i Fig. 1 visade anläggningen samt deras funktion kan kortfattat beskrivas enligt följande.

De kort som skall etsas transporteras på en transportör 33 genom en etskammare 28 och därefter genom en tvättkammare 34. Etslösning pumpas med hjälp av en pump 32 från en behållare 30 via en ledning 31 till ett perforerat rör 29 inuti etskammaren 28 och sprayas över de kort som skall etsas. Vatten pumpas medelst en pump 38 från en behållare 36 via en ledning 37 till ett perforerat rör 35 inuti tvättkammaren 34 och sprayas över de kort som skall tvättas. Färskvatten tillföres via en ledning 39.

Den förbrukade etslösningen pumpas genom en ledning 1 till en mixer-settleranläggning med ett första extraktionssteg 2, ett andra extraktionssteg 3 och ett återextraktionssteg 4.

10

15

I det första extraktionssteget bringas badet i kontakt med en organisk lösning tillförd via en ledning 5. Erhållet raffinat får passera ett avsättningssteg 7 för avskiljning av små ickeseparerade organiska droppar, varefter det leds genom ett filter 8 med aktivt kol, innan det lagras i en bufferttank 9. Den regenererade lösningen 10 återförs till etsprocessen.

Den organiska extraktlösning som lämnar nämnda mixer-settler 2 via en ledning 11 bringas i det andra extraktionssteget 3 i kontakt med tvättvatten härrörande från behållaren 36 via en ledning 12.

Den organiska lösningen lämnar nämnda mixer-settler 3 via en ledning 14. Tvättvattnet lämnar nämnda mixer-25 settler 3 via en ledning 13. Natriumhydroxid sättes till tvättvattnet genom en ledning 15, och det erhållna alkaliska vattnet leds in i en behållare 16 innehållande ett vertikalt rör 44. Detta rör 44 har öppna ändar upptill 30 och nedtill och innehåller ett värmeelement 45, med hjälp av vilket vattnet i röret bringas att koka. Röret 44 är försett med ett grenrör 46, som sträcker sig in i en sedimentationsbehållare 17. Ammoniak drivs bort från det kokande vattnet i röret 44, vilket resulterar i utfäll-35 ning av kopparhydroxid. Kokningen resulterar i förhöjd vattennivå i röret 44, vilket leder till att vatten strömmar över i sedimentationsbehållaren 17 via det grenade röret 46. Den utfällda kopparhydroxiden bildar ett skikt 47 på bottnen av sedimentationsbehållaren 17. Vatten kan avrinna från sedimentationsbehållaren 17 via en ledning 18.

Den organiska lösning som matas till ifrågavarande mixer-settler 4 genom ledningen 14 bringas i kontakt med en svavelsyralösning, som tillförs via en ledning 19. Syralösningen avgår via en ledning 20.

5

10

15

20

25

30

35

Den organiska lösningen från återextraktionen recirkuleras via ledningen 5 till steget för extraktion av koppar.

Svavelsyralösningen leds via ledningen 20 till en flotationstank 21 innehållande ett filter 22 (aktivt kol). Droppar av organisk lösning som har separerats från den vattenbaserade vätskan bildar ett ytskikt 42. De sista spåren av organisk vätska avlägsnas i filtret 22. Lösningen leds via en ledning 40 till en förråds- eller bufferttank 23.

Från denna tank 23 pumpas en del av den från återextraktionssteget erhållna kopparinnehållande syralösningen
genom ledningarna 24 och 25 till en elektrolyscell 26,
där koppar utvinnes elektrolytiskt på titankatoder 41.
Elektrolyten 27 recirkuleras till tanken 23. En del av
den genom ledningen 24 pumpade lösningen recirkuleras via
en ledning 19 till återextraktionssteget 4.

En andra del av lösningen från tanken 23 pumpas med hjälp av pumpen 101 via ledningen 107 samt via ett partikelfilter 102 och ett kolfilter 103 till en pläteringscell 112. 111 representerar den syra som används för pläteringen, under det att 110 representerar en pump för cirkulation av den för pläteringen använda syran.

Pläteringscellen 112 styrs av en likriktare 109 med pulsering och polvändning. Från pläteringscellen 112 pumpas via en pump 104, som styrs av nivån vid pläteringen, och genom ledningen 108 den förbrukade syralösningen tillbaka till förrådstanken 23. På denna väg passerar lösningen ett partikelfilter 105 och ett kolfilter 106.

Generellt gäller att man känner av kopparhalten i pläteringskretsen och doserar elektrolyt från elektrolyskretsen till pläteringen då nämnda kopparhalt understiger ett förutbestämt värde.

Den i Fig. 2 visade alternativa utföringsformen av mixer-settleranläggningen 2-4 i Fig. 1, där de hänvis-ningsbeteckningar som är gemensamma med anläggningen visad i Fig. 1 har bibehållits, innehåller som extra steg ett separat steg 3A för tvättning med vatten, så att det flöde som senare avleds för plätering blir reducerat på ämnen eller material härrörande från etsbadet och eventuellt även extraktionen. Denna mixer-settleranordning är i övrigt avsedd att fungera som anordningen i Fig. 1.

15 EXEMPEL

5

10

20

25

30

35

I en anläggning av det slag som visas i Fig. 1 på ritningen utfördes en serie försök enligt de specifikationer som redovisas i efterföljande Tabeller 1-3.

Celler fylldes med syra från en återvinningsanläggning av visat slag. I pläteringscellen hängdes 2 st anoder med dimensionerna 150 x 150 mm. Mellan anoderna placerades en platta enligt panelspecifikationen i försöksresultaten. Storleken på plattan var 100 x 100 mm och antalet hål var 10 st per platta. Avståndet mellan anod och katod var 100 mm.

Därefter startades cirkulationen av syra och luftinblåsning. Denna luftinblåsning är till för att skapa omrörning i badet men är inte alltid nödvändig. Likriktaren slogs på och kördes med de inställningar som anges i Tabellerna. Efter 10 min slogs likriktaren av och panelerna togs ut och sköljdes med vatten.

Panelerna sågades av mitt i hålen och sågkanten slipades så att man i mikroskop skulle kunna mäta beläggning i hål i förhållande till beläggning på ytan. En del av panelen användes för utförande av böjprov för bestämning av hur stor töjning de klarade.

بالقائد المالك المالة المالك المالك

Pulsationskurvorna visar de tider och strömmängder som användes för beläggning respektive upplösning.

Beträffande erhållna resultat kan man speciellt notera att de uppmätta värdena på töjning (minst ca 40% är utomordentligt goda, då man i normalfallet för mönsterkort kräver en töjning på minst 15-20% och vid mycket speciella tillfällen ca 25-30%. Ett annat krav är god beläggning i hål, där man eftersträvar ett värde på 1:1 avseende förhållande hål:yta, vilket värde tidigare ofta har varit svårt att uppnå eller åtminstone krävt stora och dyra tillsatser av olika tillsatsmedel vid pläteringen. Våra försök visar att vi kan nå ända upp -till 3:1 och aldrig ligger under 1:1.

En annan kvalitativ fördel som en följd av att tillsatsmedel eller kemikalier inte används vid pläteringen är att det inte heller blir några sådana föroreningar i använd koppar, vilket har en gynnsam effekt på kopparns ledningsegenskaper.

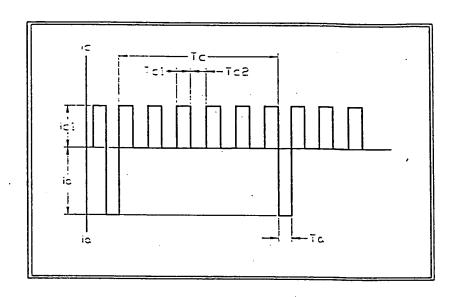
Ytterligare en kvalitativ fördel är att det är mycket lätt att anpassa förfarandet till olika typer av mönsterkort genom modifiering av inställningarna på likriktaren. Detta låter sig inte göras vid användning av kemikalier, eftersom det i så fall är stora volymer av vätskor som skall justeras.

25

10

15

Tabell 1.



Kemisk specifikation

| Kopparhalt | Syrahalt | Kloridhalt | Temperatur | Luftflöde | Cirkulation |
|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 20,5 g/l | 145 g/i | 40 ppm | 23 grad. C | 25 I/min | 300 l/tim |

Panelspecifikation

| Tjocklek | Baskoppar | Kemkoppar | Håldiameter |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1,6 mm | 17 micron | 6 micron | 0,8 mm |

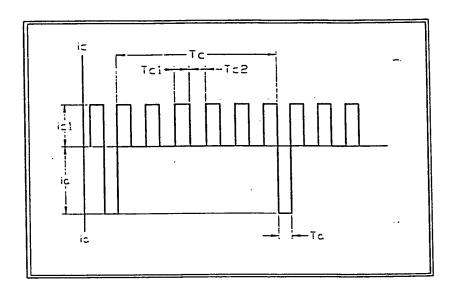
Elektrisk specifikation

| Panel nr. | ic (A/dm2) | ia (A/dm2) | Tc (sek) | Tc1 (msek) | Tc2 (msek) | Ta (sek) |
|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 1 | 3 | 4,5 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| . 2 | 3 | 4,5 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 3 | 3 | 4,5 | 20 | 40 | 40 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 6 | 2 | 3 | 20 | 40 | 40 | 8 |

Resultat

| Panel nr. | Qa/Qc | Hål-Yta förh. | Tc+Ta | Töjning | Anmärkning |
|-----------|-------|---------------|-------|---------|------------|
| 1 | 0,2 | 1,0 | 68 | 41 | |
| 2 | 0,6 | 1,4 | 28 | 40 | |
| 3 | 0,6 | 1,5 | 28 | 44 | |
| 4 | 0,2 | 1,0 | 68 | 42 | |
| 5 | 0,6 | 1,8 | 28 | 42 | |
| 6 | 0,6 | 1,7 | 28 | 46 | · |

Tabell 2.



Kemisk specifikation

| Kopparhalt | Syrahalt | Kloridhalt | Temperatur | Luftflöde | Cirkulation |
|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 20,5 g/l | 145 g/l | 40 ppm | 23 grad. C | 25 l/min | 300 l/tim |

Panelspecifikation

| 1 | Tjocklek | Baskoppar | Kemkoppar | Håldiameter |
|---|----------|-----------|-----------|-------------|
| | 1,6 mm | 17 micron | 6 micron | 0,4 mm |

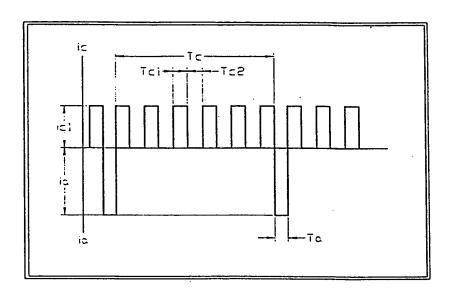
Elektrisk specifikation

| Panel nr. | ic (A/dm2) | ia (A/dm2) | Tc (sek) | Tc1 (msek) | Tc2 (msek) | Ta (sek) |
|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 1 | 3 | 4,5 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 2 | 3 | 4,5 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 3 | 3 | 4,5 | 20 | 40 | 40 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 6 | 2 | 3 | 20 | 40 | 40 | 8 |

Resultat

| Panel nr. | Qa/Qc | Hål-Yta förh. | Tc+Ta | Töjning | Anmärkning |
|-----------|-------|---------------|-------|---------|------------|
| 1 | 0,2 | 1,3 | 68 | 40 | |
| 2 | 0,6 | 2,6 | 28 | 40 | |
| 3 | 0,6 | 2,7 | 28 | 43 | |
| 4 | 0,2 | 1,5 | 68 | 42 | |
| 5 | 0,6 | 3,0 | 28 | 41 | |
| 6 | 0,6 | 2,8 | 28 | 47 | |

Tabell 3.



Kemisk specifikation

| Kopparhalt | Syrahalt | Kloridhalt | Temperatur | Luftflöde | Cirkulation |
|------------|----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 22,5 g/l | 140 g/l | 40 ppm | 23 grad. C | 25 l/min | 300 l/tim |

Panelspecifikation

| Tjocklek | Baskoppar | Kemkoppar | Håldiameter |
|----------|-----------|-----------|-------------|
| 1,6 mm | 17 micron | 6 micron | 0,8 mm |

Elektrisk specifikation

| Panel nr. | ic (A/dm2) | ia (A/dm2) | Tc (sek) | Tc1 (msek) | Tc2 (msek) | Ta (sek) |
|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 1 | 3 | 4,5 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 2 | 3 | 4,5 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 3 | 3 | 4,5 | 20 | 40 | 40 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 6 | 2 | 3 | 20 | 40 | 40 | 8 |

Resultat

| Panel nr. | Qa/Qc | Hål-Yta förh. | Tc+Ta | Töjning | Anmärkning |
|-----------|-------|---------------|-------|---------|------------|
| 1 | 0,2 | 0,9 | 68 | 39 | |
| 2 | 0,6 | 1,4 | 28 | · 39 | |
| 3 | 0,6 | 1,4 | 28 | 42 | |
| 4 | 0,2 | 1,1 | 68 | 40 | · . |
| 5 | 0,6 | 1,8 | 28 | 41 | |
| 6 | 0,6 | 1,6 | 28 | 43 | |

PATENTKRAV

- 1. Förfarande för återvinning av koppar från ett alkaliskt, företrädesvis ammoniakaliskt, etsbad från en etsprocess där mönsterkort elektropläterade med koppar et-5 sas med det alkaliska etsbadet och sedan sköljs med vatten, varvid man avlägsnar koppar från det alkaliska etsbadet genom extraktion med en organisk lösning innehållande ett reagens, som med koppar bildar en komplex förening, vilken extraheras av den organiska lösningen, 10 återför det alkaliska etsbadet till förnyad etsning, i ett återextraktionssteg bringar den organiska lösningen innehållande koppar i kontakt med en vattenlösning av en syra, företrädesvis svavelsyra, så att koppar övergår från den organiska lösningen till vattenlösningen, och 15 återför den organiska lösningen från återextraktionssteget till förnyad extraktion, kännetecknat av att man leder den från återextraktionssteget erhållna kopparinnehållande syralösningen till en operation för utvinning av koppar, företrädesvis för framställning av 20 metallisk koppar genom elektrolys, att man från den kopparinnehållande syralösningen, före operationen för utvinning av koppar från densamma, avleder ett flöde och reglerar kopparhalten i detta flöde så att den blir lägre än kopparhalten i den syralösning som används i operatio-25 nen för utvinning av koppar, och att man recirkulerar detta flöde med reglerad kopparhalt till operationen för elektroplätering av mönsterkort för användning vid denna.
- 2. Förfarande enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t av att man även avlägsnar koppar från sköljvattnet från etsprocessen genom extraktion med en organisk lösning innehållande ett reagens, som med koppar bildar en komplex förening vilken extraheras av den organiska lösningen.
- 3. Förfarande enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a t av att man använder samma organiska lösning för sköljvattnet som för det alkaliska etsbadet och därvid först avlägsnar koppar från det alkaliska etsbadet, därefter

bringar den därvid erhållna kopparhaltiga organiska lösningen i kontakt med sköljvattnet och sedan utsätter den organiska lösningen för nämnda återextraktion.

4. Förfarande enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a t av att man använder samma organiska lösning för sköljvattnet som för det alkaliska etsbadet och därvid först avlägsnar koppar från sköljvattnet, därefter bringar den därvid erhållna kopparhaltiga organiska lösningen i kontakt med det alkaliska etsbadet och sedan utsätter den organiska lösningen för nämnda återextraktion.

5

10

15

20

- 5. Förfarande enligt något av de föregåenda kraven, kännet ecknat av att det utföres som ett slutet förfarande, där det pläterade mönsterkortet etsas med nämnda alkaliska etsbad och syralösningen från pläteringen utnyttjas för nämnda återextraktionssteg.
- 6. Förfarande enligt något av de föregående kraven, känneteck nat av att man reglerar kopparhalten så att förhållandet kopparhalt i nämnda flöde:kopparhalt i nämnda syralösning blir > 0,3:1, företrädesvis > 0,5:1.
- 7. Förfarande enligt krav 6, k ä n n e t e c k n a t a v att man reglerar kopparhalten så att förhållandet ligger inom intervallet 0,60:1 0,95:1, företrädesvis 0,75:1 0,95:1.
- 8. Förfarande enligt något av de föregående kraven, kännetecknat av att man utför pläteringen i form av en pulsplätering med vågformade, företrädesvis fyrkantformade pulser för strömstyrka.
- 9. Förfarande enligt något av de föregående kraven,
 30 kännetecknat av att man utför pläteringen i
 form av en pulsplätering med polvändning.
 - 10. Förfarande enligt något av kraven 8 och 9, kännet ecknat av att man utför pulspläteringen med en pulslängd för de vågformade pulserna inom intervallet 1-500 ms, företrädesvis 10-50 ms.
 - 11. Förfarande enligt något av kraven 8-10, k ä n n e t e c k n a t a v att man reglerar den tid under

vilken mönsterkortet fungerar som katod vid pulspläteringen till ett värde inom intervallet 1-200 s, företrädesvis 10-100 s.

12. Förfarande enligt något av kraven 8-11, k ä n - n e t e c k n a t a v att man reglerar den tid under vilken mönsterkortet fungerar som anod vid pulspläteringen till ett värde inom intervallet 0,1-20 s, företrädesvis 1-10 s.

5

25

- 13. Förfarande enligt något av kraven 8-12, k ä n 10 n e t e c k n a t a v att den maximala strömstyrkan under den period då mönsterkortet fungerar som katod vid
 pulspläteringen är 10 A/dm², företrädesvis 5 A/dm² och
 allra helst 3 A/dm².
- 14. Förfarande enligt något av kraven 8-13, k ä n 15 n e t e c k n a t a v att den maximala strömstyrkan under den period då mönsterkortet fungerar som anod vid pulspläteringen är 40 A/dm², företrädesvis 10 A/dm² och allra helst 5 A/dm².
- 15. Förfarande enligt något av de föregående kraven,
 20 kännetecknat av att man reglerar kopparhalten för det till pläteringen recirkulerade flödet genom
 tillsats av syra från återextraktionssteget.
 - 16. Förfarande enligt något av de föregående kraven, kännetecknat av att man reglerar kopparhalten för det till pläteringen recirkulerade flödet till ett värde inom intervallet 5-100 g/l, företrädesvis 10-50 g/l.
- 17. Förfarande enligt krav 16, k ä n n e t e c k n a t a v att man reglerar nämnda kopparhalt till ett värde inom intervallet 15-30 g/l, företrädesvis 20-25 g/l.
 - 18. Förfarande enligt något av de föregående kraven, känneteck nat av att man reglerar halten av anjon från den använda syran, företrädesvis svavelsyra, till ett värde inom intervallet 25-250 g/l, företrädesvis 50-200 g/l, i flödet använt vid pläteringen.

- 19. Förfarande enligt något av de föregående kraven, känne tecknat av att halten av anjon från den använda syran är väsentligen densamma i operationen för utvinning av koppar som i pläteringsoperationen.
- 20. Förfarande enligt något av kraven 8-19, k ä n n e t e c k n a t a v att man utför pulspläteringen utan tillsatser av det slag som används vid ickepulsplätering av mönsterkort.

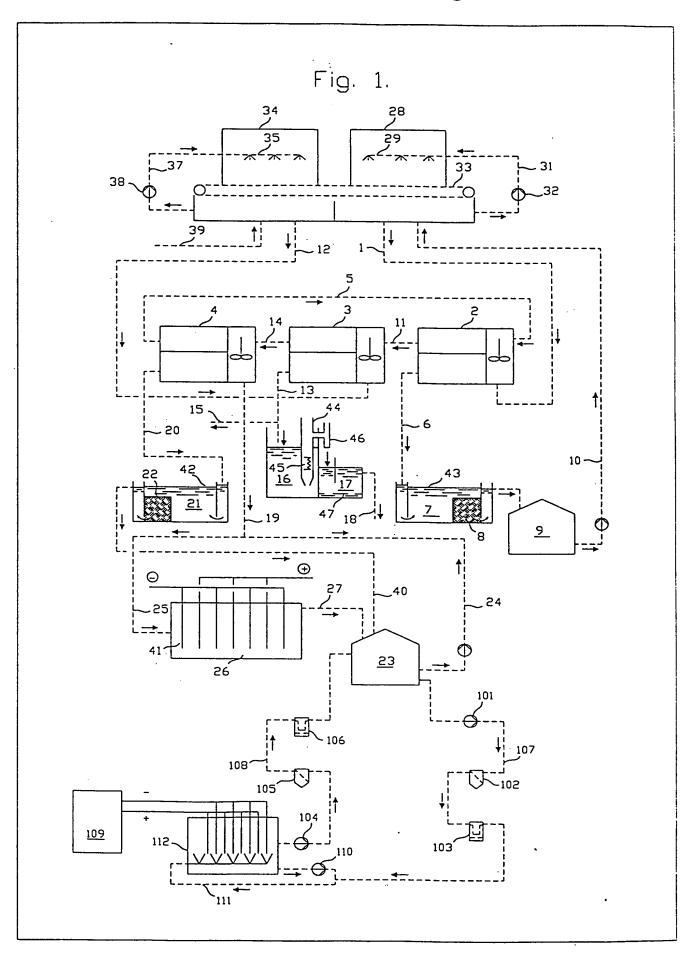
5

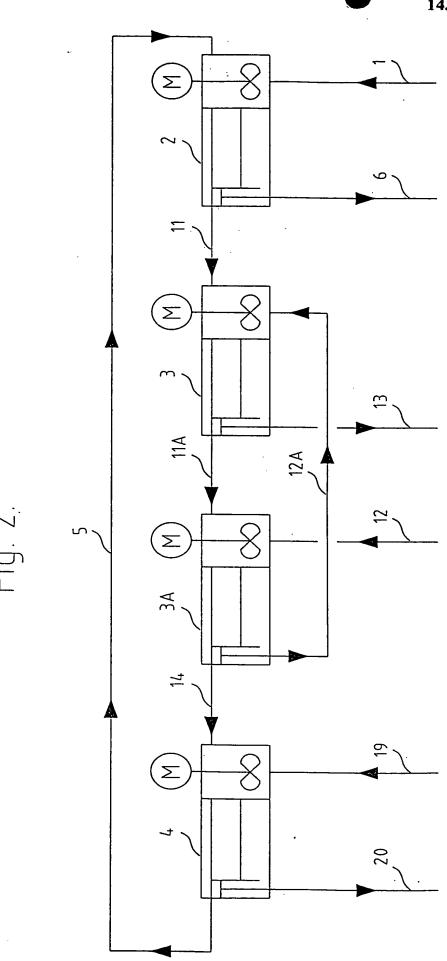
- 21. Förfarande enligt något av de föregående kraven,

 10 k ä n n e t e c k n a t a v man reducerar halten av alkaliskt ämne, företrädesvis ammoniak, härrörande från
 etsbadet och/eller reducerar halten av organiskt material
 härrörande från extraktionen i det till pläteringen recirkulerade flödet innan detta utsättes för pläteringen.
- 15 22. Förfarande enligt krav 21, k ä n n e t e c k n a t a v att nämnda reducering(ar) utförs med hjälp av ett eller flera separata vattentvättningssteg i anslutning till den utrustning som används för extraktionen.
- 23. Förfarande enligt något av kraven 21 och 22,
 20 k ä n n e t e c k n a t a v att nämnda reducering(ar)
 utförs med hjälp av ett eller flera filter, företrädesvis
 kolfilter och/eller ultrafilter.
 - 24. Förfarande enligt något av de föregående kraven, känne tecknat av att man före pläteringen avlägsnar kolloidal koppar, företrädesvis med hjälp av ett eller flera filter, speciellt ultrafilter, från det till pläteringen recirkulerade flödet.
- 25. Förfarande enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a t a v att man som utrustning för nämnda extraktion utnyttjar en eller flera extraktorer av det slag där separationen sker medelst utifrån tillförd energi.

SAMMANDRAG

Förfarande för återvinning av koppar från ett alkaliskt etsbad från en etsprocess där mönsterkort pläterade med koppar etsas med det alkaliska etsbadet och sedan sköljs med vatten, varvid koppar avlägsnas genom extraktion med en organisk lösning, från vilken den återextraheras i en syralösning. Denna syralösning leds till en operation för utvinning av koppar, t.ex. genom elektrolys, men före denna kopparutvinning avleds ett flöde, vari kopparhalten regleras till ett värde under värdet för syralösningen för utvinning av koppar, och vilket utnyttjas för pläteringen av mönsterkort.





f -

TENT COOPERATION TRE. Y

To:

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Date of mailing (day/month/year)

PACHOLIK, Robert et al

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

23 October 2000 (23.10.00)

International application No.
PCT/SE00/00066

International filing date (day/month/year)
14 January 2000 (14.01.00)

Applicant

Priority date (day/month/year)
02 March 1999 (02.03.99)

| 1. | The designated Office is hereby notified of its election made: |
|----|---|
| | X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: |
| | 26 September 2000 (26.09.00) |
| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: |
| | |
| 2. | The election X was |
| | was not |
| | made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b). |
| | |
| İ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ~ |

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

R. E. Stoffel

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Form PCT/IB/331 (July 1992)

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

SE0000066